



報道発表

2009年4月21日

報道関係各位

DFEB 技術をリードする D2S が日本法人の経営体制強化へ 新社長に元富士通マイクロエレクトロニクスアメリカ CEO の河内が就任

電子ビーム直接描画（以下、直描）技術向け DFEB(design-for-e-beam)ソリューションを提供するベンチャー企業 D2S, Inc.（本社：カリフォルニア州サンノゼ市、Chairman 兼 CEO Aki Fujimura、以下、D2S）の日本法人株式会社 D2S（本社：横浜市港北区新横浜）は、新たな取締役人事を4月21日付けで実施します。今回の人事により、元富士通マイクロエレクトロニクスアメリカ社長兼 CEO であった河内一往（かわうち かずゆき）が代表取締役社長に就任し、現代表取締役社長の吉田憲司は取締役会長に就任、また新たに、社外取締役として、日本における半導体ビジネスの成功実績豊富な Jan Goodsell（ジャン・グッドセル 現コーウェア株式会社社長）が加わります。今回の新人事により D2S 株式会社は経営体制を一層強化し、EB 直描技術の発展に寄与していきます。

D2S は設立より約2年間、先進企業とのパートナーシップにより、DFEB の基本的な技術開発とその実証を進め、その認知を国際的に展開してまいりました。今回の取締役人事は、今後はそれをより広くビジネスとして発展させるためのものです。

河内は約30年間、一貫して半導体設計技術の開発とそれを活用したビジネス展開に従事してきました。日米の半導体ビジネスに精通し、豊かな経験/実績と幅広い人脈を有しています。また、新取締役のJan Goodsellは国内におけるケイデンス、LSI Logic、コーウェアの経営経験があります。

代表取締役社長 河内一往の略歴

- 1978年 群馬大学工学部修士課程卒業後、富士通株式会社に入社、設計技術開発に従事
- 1995年 富士通 LSI テクノロジー株式会社 LSI CAD 部長に就任
- 2000年 富士通マイクロエレクトロニクスアメリカ 副社長に就任
- 2002年 富士通電子デバイスグループ テクノロジー開発統括部長就任
- 2005年 富士通マイクロエレクトロニクスアメリカ 社長兼 CEO 就任
- 2008年 富士通マイクロエレクトロニクス のシンクタンク シニアメンバーに就任



関係者のコメント

D2S, Inc. 会長兼 CEO Aki Fujimura

弊社のdesign-for-e-beam (DFEB)設計技術は前社長の吉田が2年間開発の指揮を執ってくれたおかげで、65nm以降のプロセス世代の半導体において、基幹技術が確立しました。弊社のDFEBテクノロジーの事業展開を今後拡大していく上で、河内のEDA/設計技術の知識・経験、それに富士通およびFMA（米国）での半導体ビジネスの経験や人脈は非常に有効です。今度吉田新会長に加えて最適任の人材が得られたことを喜んでいますが、また、Goodsell氏の半導体関連の知識/経験と日米間の人脈は、新会長の吉田とともに河内が進めるビジネス展開において強力なサポートとなってくれることを期待しています。

株式会社 D2S 代表取締役 河内一往

先端 LSI のマスクの複雑化とコスト高騰は半導体産業発展の大きな阻害要因になりかねませんが、D2S の革新的な DFEB 技術により、マスクレスでかつ短い TAT で LSI の開発が可能になることは半導体産業にとって大きな福音になると思います。今回先進的なチームに加わり、半導体産業の発展に寄与できることは大きな喜びです。前社長の吉田氏が会社及び DFEB テクノロジーの基盤を確立した後を引き継ぎ、今後より広くこの技術を普及していきたいと思えます。微力ですが、これまでの経験や知識を駆使して、業界の発展に努力したいと思えます。

株式会社D2S 取締役 Jan Goodsell

今回、株式会社D2Sの取締役に就任できることを大変光栄に思えます。新社長の河内氏は、昨年10月にD2Sが富士通マイクロエレクトロニクス、イー・シャトルの2社と共同発表した（「LSI 試作におけるマスクレスLSI開発のための取り組みについて」）パートナーシップを促進する上で最適な人事と考えられます。今後河内新社長と吉田新会長と密に連絡をとりながら、D2Sのビジネス展開に取り組んでいきます。

D2S について

D2S Inc.は、65nm 以降のプロセス世代の半導体の少量生産を、優れたコスト効率で実現することによって、エレクトロニクス業界における新しいビジネスチャンスを生み出すことを目指しています。その先進的な design-for-e-beam (DFEB)設計技術とソフトウェアにより、既存の EB 装置の能力を最大限に活かし、マスク費用をなくし、設計からリソグラフィまでのフローを短縮することにより、製品の市場投入までのリードタイムを短縮します。D2S Inc.は、2007年1月に米国西海岸に設立し、また、同年3月に子会社として、株式会社 D2S を新横浜に設立しました。
ホームページ：<http://www.direct2silicon.com/>

本件に関するご連絡先：

株式会社 D2S

田胡治之

Tel: 045-479-9426

E-mail: tago@direct2silicon.com

D2S 報道関係窓口

遠山直也

Tel: 080-7026-9241

E-mail: mozartant@gmail.com

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。本報道発表内で提供されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。予めご了承ください。

###